

## Contents

On tolerancing of the refractive index gradient in optical systems, K. PIE- TRASZKIEWICZ . . . . .	191
On the numerical analysis of the Fabry–Perot interferograms, A. BIELSKI, W. DO- KURNO, J. WASILEWSKI, J. WOLNIKOWSKI . . . . .	201
On the efficiency of nonlinear optical processes with respect to photon statistics of generating radiations, P. Chmela . . . . .	223
Ellipsometric examination of anodized aluminium layers within the visible spectral range, E. IDCZAK, E. OLESZKIEWICZ . . . . .	233
Influence of some cavity parameters on the experimental performance of nitro- gen lasers, E. LISICKI, M. ŁUKASZEWICZ . . . . .	243
Two-beam photoelectric vacuum reflectometer for the vacuum ultraviolet range with automatic data recording, A. KISIEL, M. PODGÓRNY, A. RODZIK, M. TU- ROWSKI . . . . .	249
An analysis of the hologram aberration in the intermediate and far regions, G. MULAK . . . . .	257
Generalized Vander–Lugt filter, T. JANNSON . . . . .	267
Letter to the Editor	
Protecting properties and behaviour of antireflection coatings, T. STEFANIAK	277
Generalized Malus law, F. RATAJCZYK . . . . .	281
Numerical recovery of the interferometrically recorded wavefronts in the intra- scanning regions, B. DUBIK . . . . .	285

## Содержание

Допустимость градиента коэффициента преламления в оптических системах, К. Пет- рашкевич . . . . .	193
О численном анализе интерферограмм Фабри–Перо, А. Бельски, В. Докурно, Й. Васи- левски, Й. Волниковски . . . . .	201
Выход оптических нелинейных процессов по отношению к статистике фотонов гене- рирующего излучения, Р. Хмела . . . . .	223
Эмисометрические исследования анодированных слоев алюминия в видимой области спектра, Э. Идчак, Э. Олешкевич . . . . .	233
Влияние параметров разрядного колодца на работу азотных лазеров, Э. Лисицки, М. Лукашевич . . . . .	243
Двупусковый вакуумный фотоэлектрический рефлектометр для ультрафиолета с авто- матической регистрацией данных, А. Кисель, М. Подгурны, А. Родзик, М. Ту- ровски . . . . .	249
Анализ aberrации голограммы в промежуточной и далёкой областях, Г. Муляк . .	257
Обобщенный фильтр Вандер–Лютга, Т. Янисон . . . . .	267
Письма в редакцию . . . . .	277

## **Editorial Board**

ZYGMUNT BODNAR — Chairman, MIRON GAJ, BEDŘICH HAVELKA, ROMAN INGARDEN, JOACHIM KLEBE, JAN MATYSIAK, MAKSYMILIAN PLUTA, ZBIGNIEW PUZEWICZ, ANTONI SOJECKI, SZCZEPAN SZCZENIOWSKI, BOGUSŁAWA TRZEBIATOWSKA

<b>Editor in Chief</b>	— MIRON GAJ
<b>Vice-editor</b>	— IRENEUSZ WILK
<b>Technical Secretary</b>	— JANINA GOWIN
<b>Editorial Office</b>	— Institute of Physics, Technical University of Wrocław, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Poland.
<b>Graphic artist</b>	— GRZEGORZ KOTERSKI
<b>Editorial Layout</b>	— MAGDALENA GUTTERWIL
<b>Verified by</b>	— RUTA CZAPLIŃSKA
<b>Proof-reader</b>	— MAŁGORZATA ŁOJEWSKA
<b>Publisher</b>	— Technical University of Wrocław, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Poland.

*Optica Applicata* has been published since 1971 in a non-periodical form. Starting from 1973 it is published quarterly

Wrocław Technical University Press  
50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Oddano do drukarni w kwietniu 1979 r. Podpisano do druku w październiku 1979 r. Papier ilustracyjny kl. III, 80g. B1. Druk ukończono w październiku 1979 r. Zam. 783/79  
**WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA**